



# テレセンθ レンズレーザ直描装置

## 基本仕様



- ビーム径 :  $\phi 3 \mu\text{m}$  /  $\phi 8 \mu\text{m}$  /  $\phi 15 \mu\text{m}$  等  
(走査幅, レーザ波長に対応)
- 走査幅 : 10mm / 60mm / 80mm 等
- レーザー : 405nm, 650nm, 780nm (半導体レーザー)  
355nm, 488nm, 532nm (固体レーザー)
- 分解能 : 5,080dpi / 2,540dpi
- 副走査 : 走査幅と同じ (但しカスタム可)
- オプション : フォーカス確認ユニット  
: エアーチャックテーブル



### [パターン描画サンプル顕微鏡写真]

405nm用液体レジストを  
Cr基材に膜厚(3  $\mu\text{m}$ )塗布。  
約  $\phi 10 \mu\text{m}$  ビーム / 5,080dpi でデータ露光



[10  $\mu\text{m}$  L/S data]



[5  $\mu\text{m}$  L/S data]

[お問い合わせ先] (株) オプセル [埼玉研究室]  
〒333-0844 埼玉県川口市上青木3-12-18  
埼玉県産業技術総合センター内752研究室  
TEL: 048-260-3308 FAX: 048-260-3309